⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-127816

®Int. C1. 5

織別配号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)5月30日

H 01 L 21/027 7/125 7/14 G 11 B

A

8947-5D 8947-5D

7013-5F 7013-5F H 01 L 21/30

B W 3 4 1

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

60発明の名称 マルチ電子源

> 頭 平1-267575 ②特

平 1 (1989)10月13日 22出

何発 明 者 塚 本 健 夫 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

朙 者 渡 個発

辺 男 倌 貫 昌 彦 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

キヤノン株式会社内

個発 明 者 奥 願

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

创出 人 キャノン株式会社 四代 弁理士 福森 理 久夫

明和

1. 発明の名称

マルチ電子数

2. 特許請求の範囲

それぞれ電子ピームを放出する多数の電子域を 縦列および横列のマトリクス状に基板上に配置 し、射出された電子ピームを被照射体に照射すべ く各前記電子版を順次駆動するようにして成るマ ルチ電子部において、前記縦列に沿う前記電子標 の配列方向と前記機列に沿う前記電子還の配列方 向とを直交させないように設定したことを特徴と するマルチ電子源。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

太発明は、例えばレジスト指頭用装置、電子 ピーム記録用鼓置等のように、例えばショット キー型半導体電子認から放出する電子ピームを用 いて微細かつ高密度の電子ピーム照射を行なう べく使用されるマルチ電子様に関するものであ

[従来技術]

従来、この種のマルチ電子類としては、例えば 米国特許第4.259678号明細書、米国特許 4303930号明細書に記載されているような ものが知られている。これによると、マルチ電子 塚は、多数の電子器が縦列および横列のマトリク ス状に基板上に配置され、各前記電子悪を順次一 方向に駆動するようにして成り、各電子派の横の 配列方向(×方向)と群の配列方向(y方向)と のなす角度が直交したいわゆる単純マトリクスで 配置した構成となっている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来技術の構成では、×方 向とy方向とのなす角度が直交しているので、例 えば被照射体たる移動物体に向けて各電子振から 電子ピームを放出する場合、電子ピームを移動物 体上で連続的に照射させるようにしようとする と、各電子源は固定されていることから、移動物 体の移動距離に応じて各電子類を一個すっ個別に 刻御(いわゆる点順次駆動制御)しなければなら ない。接召すれば、従来技術の様成は、制御用に 読み込ませるデータが多岐になること、電子ピー ムの放出制御が複雑であること、電子ピームの放 出のタイミング的余裕度が極めて制約される等の 問題があり実用性に乏しいものである。

本発明は、簡単な改良を加えることにより、特に移動物体に対する電子ビームの照射を容易に行なえるようにしたマルチ電子源を提供すること目的とする。

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく本発明は、それぞれ電子ビームを放出する多数の電子器を段列および横列のマトリクス状に基板上に配置し、放出された電子ビームを被照射体に照射すべく各前記電子環を順次駆動するようにして成るマルチ電子部において、前記級列に沿う前記電子環の配列方向とを直交させないように設定したことを特徴とする。
【作用】

基板上に配置されたマトリクス状電子瓶の横列

は、配線用の跛段状に形成された板状電極 4 が名イオン注入領域 2 と交叉するように、 すなわち級方向 (各 y 方向 a 、 b 、 c 、 d …) に形成されている。 したがって、 8 y 方向 a 、 b 、 c 、 d … における各高濃度イオン注入領域 3 を結ぶ線と各 x 方向 A 、 B 、 C 、 D … における各高濃度イオン注入領域 3 を結ぶ線とのなす角度は度交していない(X 方向に沿う線(X — X 脚)と Y " — Y "線とのなす角度 8 は B C 度よりも小である)。

さらに、前記イオン注入領域2上には、前記高 議屈イオン注入領域3から放出された電子を上方 に案内するべく脚状の電極5を介して平屋根状の 電極6が形成されている。

各前記イオン注入領域2の鳩郎の表面部にはそれぞれ高級度拡散層7が形成され、各高級度拡散層7上にはオーミックコンタクト部8が失々形成され、各オーミックコンタクト部8上には電極9がそれぞれ接続されている。また、各前記板状電極での猟師にはそれぞれ電極11が接続されてい

方向と取列方向とが直交しないので、各電子思からお助物は上に連続的に電子ピームを照射する場合、お助物体が一つの電子源とこれに開接する電子思との間をお助する時間内に、一の列の全部のマトリクス電子振を次々と駆動(練順次駆動)をせるという単純な制御で行なえる。

第1 図乃至第3 図は第1 の実施例を示すものである。図中1 は例えば半絶経性のG * A * 基板であり、該基板1上にはP型のイオン往入領域2 が 根方向(×方向)に所定間隔を置いて直線状に注 入形成され、該各イオン往入領域2 の表面部には

[実度引]

電子源を構成するP型高濃度イオン往入領域3が 横方向(各×方向A、B、C、D・・・・)に沿い所定 関隅を置いて形成され、就各イオン往入領域3上 にはショットキー電極10が形成され、各イオン 往入領域3は全体としてマトリクス状に配置され ている。ここで、高濃度イオン往入領域3は各×

方向A、B、C、D…毎に所定距離だけ順次シフ

トレている。また、各前記イオン往入領域2上に

従って、マトリクス状に配列された各電子派は、各×方向A、B、C、D…の所定の電極9と各ッ方向a、b、c、d…の所定の電極10との間に逆パイアス電圧を印加すると、該両電極の交点位置にある電子原である高機度イオン往入領域3がON状態となってアパランシェ増幅が生じ、当該高機度イオン注入領域3からスポット状の電子が放出される。

なお、本実施例では電子源としてショットキー型半導体電子原を用いているが、特にショットキー型半導体電子源である必要はなく、PN接合、NEA(負の電子規和力)等の各種の半導体電子原を用いることが出来る。

次に、本実施例により電子ピームを移動物体に照射し、連続的なピーム照射領域を形成するための手順につき述べる。

まず、電子ビームが照射されるべき領域をマトリクス電子域に対向した位置に置く。この場合、例えば×方向Aの電極2と各y方向 a . b . c . d ... の電極4との交点位置の電子機をON状態に

するか O F F 状態にするかは予め何らかの方法で 決められており、電極 2 と各 y 方向 a . b . c . d … の電極 4 との間への逆パイアス電圧印知によ り、 x 方向 A の各電子機から顧次電子放出が生じ る。

次に同様な方法で他のX方向B。C、D…の電 極2と各y方向 a、b、c、d…の電極4との間 への逆パイアス電圧印加によりそれぞれ線膜次駆動する。

全部のマトリクス位置の電子源を駆動し終えた 技に、一の電子源とこれに開接する他の電子源と の間の距離だけ移動物体を従前の移動方向と する方向に 9 0 度の方向に移動させ、再び各 X X 方向 A 。 B 。 C 。 D ···· と各 y 方向 a 。 b 。 c 。 d ··· との交点位置の電子源を順次駆動する。かか在 電子源を設動を繰り返すことにより、移動物体の祇照 射面を電子ビームにより全面照射することができる。

第4図は、マルチ電子液を電子ピームメモリに 適用した場合を示している。12は上記第1の実

第5図は、マルチ電子標を電子ビーム指面装置 に通用した場合を示している。同図において、マ ルチ半導体電子類12は上配第1の実施例で述べ たと同様な構成のものである。19は半導体ウェ ハーであり、20はレジスト上に描かれた電子 ビーム照射領域である。

前記マルチ電子振12の駆動手順は上記第2実施例とほぼ同様であるが、該電子振12の駆動制

庭例で述べたと同様な検点のマルチ半導体電子源、13はフォトダイオード、14は光を実空零器へ入れるための導入部、15は光信号を送るためのファイバー、18は高圧電源、17は電子線を設動させるための電源、18は電子線配録媒体である。該配録媒体18としてはSiのMOS機造、アモルファス状のSiOs構造、A43の。 設およびSiN膜等の多階膜構造のものがある。

上記のように構成されているので、マルチ電子 源12の駆動用の制御信号は、搬送クロックと同 時に多重させ光信号として光ファイバー15を介 して伝達され、フォトダイオード13で再び電気 信号に戻される。マルチ電子振12は高圧電源 16が接続されることにより高電圧になっている が、制御信号は光媒介としており、電気的に絶縁 されているので耐ノイズ性に優れている。

マルチ電子振12の光制調信号は、フォトダイ オード13で電気信号に変換され電気制御信号と しての復興制御信号となる。該制御信号はマルチ

8

如はウェハー19のステージ移動に広で、括回すべき全エリアにおいて電子源12を順次線駆動を行う。

[発明の効果]

以上のように本発明によれば、それぞれ電子 ピームを放出する多数の電子源を縦列および横列 のマトリクス状に基板上に配置し、放出された電 子ピームを被照射体に照射すべく各前記電子標を 順次駆動するようにして成るマルチ電子源におい て、前記段列に沿う前記電子源の配列方向とを前記 切が記憶を開放としたので、従前の構成に なが、はな手段を講じるだけで、遠眺した電子 ピーム照射観紙を形成できると共に、制御のため の信号設定が単純化でき、この単純化により制御 回路が微略化することができる。

さらに、マルチ電子版をマトリクス状に構成して順次線駆動するため、移動体に同一の電子ビームの照射領域を形成しようとする場合、電子運が一次元配列である場合に比べて、移動体の移動連

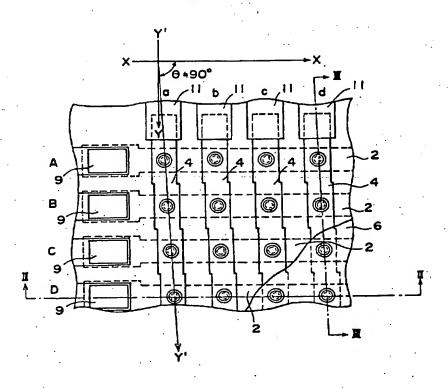
度を低下することができ、験電子ビームの照射領 域が楕円変形するのを小さくすることができる。 また、電子ビームの照射領域を連続かつ高密度で 形成できるので、電子線メモリ、抽回装置の値、 電子線プリンター等の広範囲の応用が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1回乃至第3回は本発明の一実施例を示すものであり、第1回はマルチ電子原の平面図、第2回は第1回の用一川線に沿う断面図、第3回は第1回の町一川線に沿う断面図、第4回は電子ピームメモリ装置への応用例を示す平面図、第5回は電子ピーム揺回装置への応用例を示す平面図であ

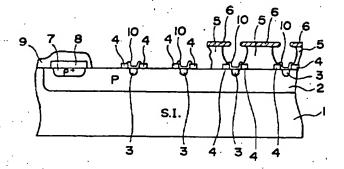
1 … 基板、 3 … P型高級度イオン往入領域(電子源)、 1 0 … ショットキー電極(電子源)、 1 2 … マルチ電子源。

第 | 図

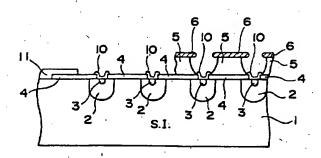


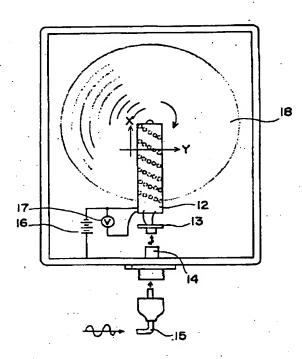
第2回



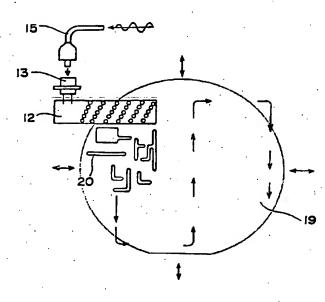


第3図





第 5 図



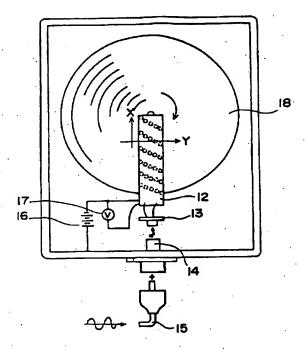


平成2年 2月 6日

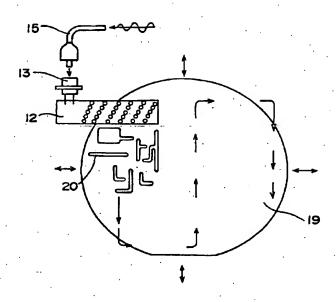
特許庁長官

- 1.事件の表示 平成元年特許顯第267575号
 - 2. 発明の名称 マルチ電子源
 - 3. 補正をする者
 - 事件との関係 特許出職人
 - 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 住
 - 称 (100)キャノン株式会社
 - 代表者 山 路 敬 三
 - 4.代理 人 〒180 電話03(358)8840
 - ·住 所 東京都新宿区本塩町 1.2
 - . 四谷ニューマンション107
 - 丘 名 (8809) 弁理士 福森久夫
 - 5. 補正命令の日付(発送日) 平成2年 1月30日
 - 6. 補正の対象
 - 図面 (第4.5図)
 - 7. 補正の内容 別紙の通り





第 5 図



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-127816

(43)Date of publication of application: 30.05.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G11B 7/125 G11B 7/14

(21)Application number: 01-267575

(71)Applicant: CANON INC

(22) Date of filing:

13.10.1989

(72)Inventor: TSUKAMOTO TAKEO

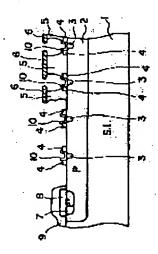
WATANABE NOBUO

OKUNUKI MASAHIKO

(54) MULTIPLE ELECTRON SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily irradiate a moving article with an electron beam through a simple improvement by so setting an arraying direction of electron sources disposed along a longitudinal row as not to cross the arraying direction of electron sources disposed along a lateral row. CONSTITUTION: The arraying direction of electron sources 3 disposed along a longitudinal row is so set as not to cross the arraying direction of electron sources 10 disposed along a lateral row. Thus, since the lateral and longitudinal directions of the matrixlike sources 3, 10 disposed on a board 1 are not perpendicularly crossed, if a moving article is continuously radiated with an electron beam from the sources 3, 10, the entire sources 3, 10 of one row can be sequentially driven (linearly and sequentially drive) under a pure control within time moving the article between the source 3 and the adjacent source 10. Thus, continuous electron beam irradiation region is formed by simple means, and signal setting for control is simplified, and further a control circuit is simplified due to the simplification.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	-
□ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	•
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS .	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.